М.А. Шерметова, аспирант Н.Н. Герасименко, д.ф.-м.н., профессор (НИУ «Московский Институт Электронной Техники», г. Зеленоград, г. Москва) e-mail: <u>shermetova.madina@mail.ru</u>

НАНОПОРОШОК КРЕМНИЯ ОБЛУЧЁННЫЙ ВЫСОКОЭНЕРГИЧНЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ

Развитие научных подходов и технологий в промышленных, научно-исследовательских и оборонных направлениях заставляет решать задачи исследования и создания новых материалов для микрои наноэлектроники с повышенной радиационной стойкостью. В последние годы наблюдается повышенный интерес к свойствам нанопорошков и возможности их использования в электронной технике.

Наиболее распространенными методами получения порошков с наноразмерными параметрами являются плазмохимический метод, взрывной метод, метод газофазных реакций, метод осаждения, метод механохимического синтеза, метод диспропорционирования. Использованный в работе нанопорошок кремния был получен методом механохимии.

Образцы нанопорошка кремния представляют собой агломераты наноразмерных частиц, покрывающих поверхность крупных микронных кристаллов кремния и диоксида кремния (рисунок 1).



Рисунок 1 – РЭМ снимок кремниевого порошка. a) увеличение 10000х, б) увеличение 500000х

Для обнаружения эффекта увеличения радиационной стойкости в образцах нанопорошка, размеры зерен должны быть меньше размерного порога, составляющего величину порядка 30 нм. для кремния [1]. Для получения более точной информации о размерах порошинок был определен усредненный размер зерен по всему объему нанопорошка методом малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР).

МУРР проводились на многофункциональном Измерения дифрактометре «Минилаб-6». Система рентгеновском монохроматоров и детекторов позволяет проводить измерение сразу на 2-х длинах волн СиКа (1.54Å) и СиКβ (1.39Å). В результате измерения получается зависимость интенсивности рассеянного излучения от угла поворота детектора. Используя полученную установлено, зависимость ЧТО средний размер рассеивающих объектов, т.е. кремниевых зерен в порошке, составляет 29,2 нм. Проведенные рентгеновские исследования позволяют с большой степенью однозначностью заключить, что представленный образец является кристаллическим нанопорошком кремния. Основная масса нанокристаллитов порошка имеет размеры, находящиеся в пределах 20-40 нм.

Облучение проводилось на линейном ускорителе электронов УЭЛВ-10-10. Энергия бомбардирования электронами для всех образцов была одинаковой и составляла 6 МэВ, а максимальная доза – 1,2·10¹⁶ см⁻². Исследовались образцы до облучения (контрольные) и после облучения.

Для каждого дифракционного пика и для каждого образца была произведена аппроксимация функцией Войта (сумма функции Гаусса и Лоренца) и расчет FWHF (ширина на половине высоты максимума пика) по формуле (1)

$$FWHF = 0.5346wL + \sqrt{0.2166(wL)^2 + 2ln2(wG)^2},$$
(1)

где wL – ширина кривой Лоренца, wG – ширина кривой Гаусса

Результаты расчета и исходные данные представлены в таблице 1.

Номер образца	Параметр	Значение для плоскости (111)	Значение для плоскости (220)
Контрольный	wG, град.	2,7.10-5	0,4544
	wL, град.	0,64132	0,0982
	FWHF, град.	0,64132	0,5894
Nº1	wG, град.	3,5.10-6	0,216
	wL, град.	0,403	0,3111
	FWHF, град.	0,403	0,4593
<u>№</u> 2	wG, град.	5,9·10 ⁻⁶	0,224
	wL, град.	0,4029	0,2682
	FWHF,	0,4029	0,4567

Таблица 1 – Исходные данные и результаты расчета FWHF.

	град.		
N <u>0</u> 4	wG, град.	9,1.10-8	0,2656
	wL, град.	0,4753	0,2715
	FWHF, град.	0,4753	0,4828
N <u>⁰</u> 5	wG, град.	3,4.10-7	0,402
	wL, град.	0,4022	0,122
	FWHF, град.	0,4022	0,5281
N <u>2</u> 6	wG, град.	1,2.10 ⁻¹⁵	0,1674
	wL, град.	0,4035	0,4302
	FWHF, град.	0,4035	0,5109

На рисунке 2 представлена зависимость параметра FWHF от дозы облучения (номера образца).



Рисунок 2 –Зависимость FWHF от дозы облучения

Заметно, что ширина на полувысоте меняется для двух кристаллографических ориентациях по-разному. Для (111) она незначительно, в то время как для (220) изменения более существенно.

Авторы работы [2] показали, что значения ширины на полувысоте эффекты пика позволяет разделять уширения линий, дифракционных связанные С малыми размерами И микродеформацией, а в некоторых случаях оценить концентрацию дефектов упаковки. Задача существенно упрощается, если использовать ширину максимума, линий на половине высоты

дифракции, где интегральная ширина примерно на 10 % больше полуширины [3]. Кристаллы малого размера вызывают уширение линий дифракции и интегральная ширина профиля дифракционной линии обратно пропорциональна размеру кристаллитов в образце.

В результате на образцах после облучения совершенная область, на которой идет дифракция, увеличилась, что в свою очередь означает уменьшение количества дефектов в кристаллах. Это можно связать с увеличением размеров кристаллита (связанно с слипанием/спеканием нанопорошинок в кластеры/конгломераты) и из-за радиационного отжига дефектов при облучении высокоэнергичными электронами электронов Взаимодействие высокоэнергичных [4,5]. С кристаллической решеткой образца создает подвижные собственные дефекты, которые в процессе своей эволюции формируют более крупные дефектные кластеры меньшей концентрации, тем самым увеличивая общее структурное совершенство образца. Увеличение области когерентного рассеивания свидетельствует о том, что у образца повышается структурная радиационная стойкость.

ЛИТЕРАТУРА

1 Герасименко Н. Н. и др. Особенности формирования рельефа при травлении кремния фокусированным ионным пучком //Письма в ЖТФ. – 2010. – Т. 36. – №. 21. – С. 38-45.

2 Lutterotti L., Scardi P. Simultaneous structure and size-strain refinement by the Rietveld method //Journal of Applied Crystallography. – 1990. – T. 23. – No. 4. – C. 246-252.

3 Иверонова В. И., Ревкевич Г. П. Теория рассеяния рентгеновских лучей: Учебное пособие. – МГУ, 1972.

4 Герасименко Н.Н., Двуреченский А.В., Качурин Г.Ф., Придачин Н.Б., Смирнов Л.С. Радиационный отжиг дефектов, образующихся при бомбардировке кристаллов ионами. // ФТП. – 1972 г. – Т.6. – С. 1834 – 1835.

5 Mikhailov M. M. et al. Absorption band of Y2O3 micro-and nanopowders induced by proton and electron bombardment //Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. – $2017. - T. 11. - N_{\odot}. 4. - C. 827-831.$

УДК 541.13